PASJ2020 WEPP46

パルス 6 極電磁石で発生する渦電流の影響を抑える セラミックチェンバーのコーティングパターンについての評価 EVALUATION OF COATING PATTERN OF CERAMICS CHAMBERS TO REDUCE THE EFFECT OF EDDY CURRENTS BY THE PULSED SEXTUPOLE MAGNET

高木宏之*^{A)}、満田史織^{A)}、魯垚^{B)}、帯名崇^{A)}、高井良太^{A)}、野上隆史^{A)}、 内山隆司^{A)}、原田健太郎^{A)}、上田明^{A)}、長橋進也^{A)}、小林幸則^{A)}

Hiroyuki Takaki*^{A)}, Chikaori Mitsuda^{A)}, Yao Lu^{B)}, Takashi Obina^{A)}, Ryota Takai^{A)}, Takashi Nogami^{A)},

Takashi Uchiyama^{A)}, Kentaro Harada^{A)}, Akira Ueda^{A)}, Shinya Nagahashi^{A)}, Yukinori Kobayashi^{A)}

^{A)}High Energy Research Organization (KEK), 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

^{B)}The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), 240-0193, Hayama, Japan

Abstract

The Photon Factory has been continuously developing a new technology for the top-up injection using pulsed multipole magnets. One of the important issues to be solved in this injection is the effect of eddy currents generated by the multipole magnets and the inner coating of the ceramic ducts on the stored beam. The magnetic field of the pulsed multipole magnet is designed so that it does not affect the stored beam, however, the eddy currents that occurred on the coating give an unwanted kick to the stored beam at the injection. In this paper, we report the coating pattern of ceramic chambers to reduce the effect of the eddy currents.

1. はじめに

高エネルギー加速器研究機構では、パルス多極 電磁石によるトップアップ入射の新技術の開発を 不断に進めている。これは、Photon Factory Advanced Ring(PF-AR) における 2005 年のパルス4 極電磁石を 用いた入射 [1] から始まり、Photonn Factory (PF) にお いては、2010年からパルス6極電磁石1号機(PSM1) を用いたトップアップ入射をユーザー運転を提供し (2011年3月に起きた震災後半年間の中断があった が 2011 年秋より復帰し) 大きな成果を上げた [2]。 2014年からは、セラミックダクトの形状を円形(内 径 60mm から) 長方形 (68mm x 18mm) に変更しそ れに合わせて6極磁石自身も新形状のもの(PSM2) へと作り変えた(Fig. 1)。新形状の PSM2 では、入 射時のビームロスを抑えるために水平方向の物理口 径を大きくし、低いピーク電流で入射に必要なパル ス磁場を発生させることができるように垂直方向の 磁極の距離を短くした。この改造によって、PSM1 に比べて入射が楽になる予定であったが、PSM1 に おいて 200 µm 程度であった蓄積ビームの水平振動 が、PSM2を用いた入射では数mmも発生してしま い、結果としてユーザー運転での PSM2 の利用は出 来なくなった。

この入射時の蓄積ビームの振動の原因のひとつと して、セラミックダクト内面の Ti コーティングで発 生する渦電流が考えられる。通常、セラミックチェ ンバーの内部は、ビーム壁電流のインピーダンスを 今回、3次元の磁場解析コードを用いて現在の コーティングで発生する渦電流の影響を見積るとと もに、渦電流が蓄積ビームに影響を与えないような コーティングパターンについて検討し評価したので 報告する。



Figure 1: Photos of pulsed sextupole magnets. PSM1(left) and PSM2(right).

抑制するために導電性の物質でコーティングしてい るが、パルス磁場がこのコーティングを抜けようと するとその磁場の変化を抑えようとしてコーティン グ面に渦電流が発生する。パルス多極入射において は、入射時に蓄積ビームが振動しないよう蓄積ビー ムが通過する場所における磁場成分がゼロになる電 磁石を設計しているので、この渦電流に起因する余 分な磁場が発生してしまうと蓄積ビームを振動させ てしまうことになる。

^{*} hiroyuki.takaki@kek.jp



Figure 2: Layout of the magnet, slits, and chamber coating.

2. 6極電磁石とチェンバー内コーティン グのモデリング

パルス6極電磁石によってセラミックチェンバー 内部のコーティングで発生する渦電流を見積るにあ たり、要素を3次元でモデリングし計算を行った。 使用した3次元の磁場解析コードは ELF/MAGIC (株 式会社エルフ)で、コードの特徴として積分要素法 を使用している [3]。

まず、電磁石については空芯とし棒状のコイルが 存在するだけとした(Fig.2参照)。コイルは6極磁 場が発生するように蓄積ビームの軌道を中心とした 同心円上の6回対称の位置に配置した。セラミック チェンバーのコーティング面に発生する渦電流は、 コーティング面を通過する磁場に対するリアクショ ンという形で発生するので、発生する磁場に対して 何%の磁場が渦電流によって生じたかという形で評 価をおこなえば空芯にして簡略化する事ができる。

次に、コーティングは 3 μ m 厚の Ti ととし全面 で均一な厚さとした。セラミック部分はモデリン グの必要がないので、コーティング面はビーム中心 (x=y=0)の±9mm に配置した W=68mm, L=300, t=3 μ mの Ti の板 2 枚の板となる。チェンバー側面部の コーティングは蓄積ビームに対して水平の振動を起 こす磁場を発生させないので無視する。

このコーティング面に対してパターンを作る場 合、Fig. 2 に示すように z 軸に沿って x 方向に切れ 目を入れ板状のコーティングを作る。このコーティ ングを区切る部分をスリットと呼ぶことにし、その 幅は 1mm とする。各コーティングパターンは板状と し、各パターンは z 軸上の両端が電気的に絶縁され ており渦電流は板状の面内にしか流れないとする。 評価する磁場は Fig. 2 のチェンバー中心(y=z=0)に 発生するもののみとする(対称性から By だけが発生 する)。コーティング幅を 5mm, 10mm, 15mm, 20mm と変え、全面コーティング(現状)及びコーティン グ無し(渦電流なし)の場合と渦電流の影響を比較 する。

次に、コイルに流すパルス電流は、Fig.3のように 幅 1.2µsec のハーフサイン、ピーク電流は 1000A とし た。PF にインストールしたパルス6 極電磁石のコイ ルは1ターンなので、図中の隣り合うコイルは交互 に逆向きのパルス電流が流れることになる(図中の 同色の3本のコイルは同方向に電流が流れるグルー



Figure 3: Time evolution of the applied current.

プである)。磁場の過渡計算において、電流はハーフ サインの部分を20分割し、1ステップ0.6 μsec で刻 んだ。電流のピーク値は10ステップ目にあり、21~ 30ステップ目までは0Aとした。また、コイルの材 質は銅とした。

3. 全面コーティングの場合

全面コーティングにおいては、Fig. 4 に示すよう にスリットの無い 2 枚のコーティング面で蓄積ビー ムを挟む形になる。このモデルに対して Fig. 3 の電 流を流すと、Fig. 4 の赤線で示す測定領域 (y=z=0mm で x=0~15mm) における磁場の時間的変化は Fig. 5 のようになる。

渦電流の影響のひとつは、時間と共に x 軸方向に 6 極磁場が発生し消えて行く様子に現れている。グ ラフの縦軸は、内部コーティングがない(渦電流が 発生しない)場合に x=15mm の場所に発生する磁場 のピークを 100% として規格化している。本来 10 ス テップ目でピークを迎えるはずの磁場が、2~3ス テップ遅延してピークを迎えるとともにそのピーク が 100% に達していないのは渦電流の影響である。



Figure 4: Full coating case.

PASJ2020 WEPP46



Figure 5: Time evolution of the sextupole field.

渦電流の影響が見えているもうひとつの点は、蓄 積ビームが通過する x=0mm において発生した6極 磁場を打ち消すようなタイミングで逆向きの磁場が 発生している部分である。ここではピーク磁場の微 分波形に似た渦電流独特の磁場の時間発展が見えて おり、効果としてはパルス磁場の渦電流無しの時の ピーク値に対して 10% 弱の強さとなっている。残念 ながら、今回 x=0mm で渦電流により発生した磁場 は、過去に行った積分磁場の実測結果を完全に説明 するものではなく、電磁石本体に起因する渦電流の 効果についても今後詳細に検討する必要がある。こ の6極電磁石本体に起因する渦電流については、本 学会で総研大の魯氏により「KEK-PF におけるパル ス六極電磁石の精密磁場測定による渦電流効果の評 価」(WEPP45) で報告されているのでそちらを参考 にされたい。

4. スリットを入れた場合

セラミックチェンバーの内側に全面均一のコー ティングを施すと、そこに発生した渦電流が蓄積 ビームに対して影響を及ぼすというのが前章の結果 である。これに対して、コーティング面のz軸に沿っ て x 方向に幅 1mm のスリットを入れてコーティン グ面を分割し板状にする。分割された板状のコー ティングの配置は、まず蓄積ビームが通過する位置 x=0 の部分に板状コーティングの中心線が来るよう に配置する。その後、この板状コーティングの左右



Figure 6: Plate-coating arrangement.

にスリットを配置し更に次の板状コーティングを配置する。したがって、配置したスリットは x=0 に対して対称性を持つ事になると共に、ビーム軸の鉛直方向に対しては必ずコーティングが存在することになる。Figure 6 に示すように、コーティングの幅が5mm、10mm、15mm、20mm の4 種類を用意し計算を行った。

Figure 7 は、蓄積ビームが通過する位置における 渦電流の影響を示している。コーティング無し (w.o. coat)の時には渦電流による磁場は発生していない が、前章でも述べたように、全面コーティング (all coat)では渦電流による磁場が発生している。コー ティング面にスリットを入れた場合、幅が 5~15mm ではほぼ渦電流の影響を抑える事ができる事がわか る。幅が 10mm 以下だと影響もピークで 1% 以下と なっている。

Figure 8 は渦電流の影響で必要とする6 極磁場に 遅延が発生するとともに磁場強度も下がるという事 を示しているが、スリットを入れる事で遅延も磁場 の低下も抑えられる事が分かる。



Figure 7: Effect of eddy currents on the stored beam.



Figure 8: Effect of eddy currents on the injection beam.

PASJ2020 WEPP46

5. まとめ

PF において、パルス6極電磁石設置箇所に用いて いるセラミックチェンバーの内面コーティングは、 今までは全面均一の Ti コーティングを施していた。 このコーティングで発生する渦電流が蓄積ビームに 対して影響を与える事が計算からも判明した。この コーティングに対して、幅 1mm スリットを数 mm 間 隔で入れ櫛歯構造のコーティングにする事により、 全面コーティング時に渦電流に起因して発生してい た x=0 付近における By を抑える事ができる事が分 かった。また、この構造だと本来必要となる6 極磁 場成分も 0.1% 以下にすることができた。

今後、このコーティングパターンを施したセラ ミックチェンバーを PF リングに導入し、入射時の蓄 積ビームの振動が抑えられるようになるかについて ビーム試験を行う予定である。

参考文献

- [1] K. Harada *et al.*, Phys. Rev. ST Accel. Beams **10**, 123501 (2007).
- [2] H. Takaki *et al.*, Phys. Rev. ST Accel. Beams **13**, 020705 (2010).
- [3] http://www.elf.co.jp/